

NR21 20000P光刻胶 赛米莱德 光刻胶

产品名称	NR21 20000P光刻胶 赛米莱德 光刻胶
公司名称	北京赛米莱德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208
联系电话	15201255285 15201255285

产品详情

光刻胶介绍

光刻胶介绍

光刻胶(又称光致抗蚀剂),是指通过紫外光、准分子激光、电子束、离子束、x射线等光源的照射或辐射,其溶解度发生变化的耐蚀刻材料。光刻胶具有光化学敏感性,其经过曝光、显影、刻蚀等工艺,可以将设计好的微细图形从掩膜版转移到待加工基片。因此光刻胶微细加工技术中的关键性化工材料,被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作。生产光刻胶的原料包括光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂)、光刻胶树脂、单体和其他助剂等。

光刻胶市场

全球光刻胶市场扩增,对光刻胶的总需求不断提升。据估计,2015年国际光刻胶市场达73.6亿美元,其中PCB光刻胶占比24.5%,LCD光刻胶占26.6%,半导体光刻胶占比24.1%。2010年到2015年期间,国际光刻胶市场年复合增长率约为5.8%;据中国产业信息网数据,2015年,PCB光刻胶、LCD光刻胶和半导体光刻胶的国际市场增速均在5%左右。在下游产业的带动下,江瀚咨询预计国际光刻胶市场规模在2022年可能突破100亿美元。

NR9-3000PY 负性光刻胶

负胶 NR9-3000PY 被设计用于i线(365 nm)曝光,可使用如步进光刻、扫描投影式光刻、接近式光刻和接触式光刻等工具。

显影之后，NR7 6000PY光刻胶，NR9-3000PY 展现出一种倒梯形侧壁，NR21 20000P光刻胶，这可以方便地作单纯的LIFT-OFF 处理。

NR9-3000PY 相对于其他光刻胶具有如下优势：

- 优异的分辨率性能
- 快速地显影
- 可以通过调节曝光能量很容易地调节倒梯形侧壁的角度
- 耐受温度100
- 室温储存保质期长达3年

Lift-Off工藝

應用領域：LEDs，NR74g 3000PY光刻胶，OLEDs，displays，MEMS，packaging，光刻胶，biochips。

濕法蝕刻，鍍 干法蝕刻（RIE/Ion Milling/Ion implantation）

附着力好Temperature resistance = 100 ° C 耐高溫Temperature resistance = 180 ° C

Resist Thickness NR9-3000PY 负性光刻胶

负胶 NR9-3000PY 被设计用于i 线（365

nm）曝光，可使用如步进光刻、扫描投影式光刻、接近式光刻

和接触式光刻等工具。

显影之后，NR9-3000PY 展现出一种倒梯形侧壁，这可以方便地作单纯的LIFT-OFF 处理。

NR21 20000P光刻胶-赛米莱德-光刻胶由北京赛米莱德贸易有限公司提供。北京赛米莱德贸易有限公司（www.semild.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，赛米莱德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：况经理。